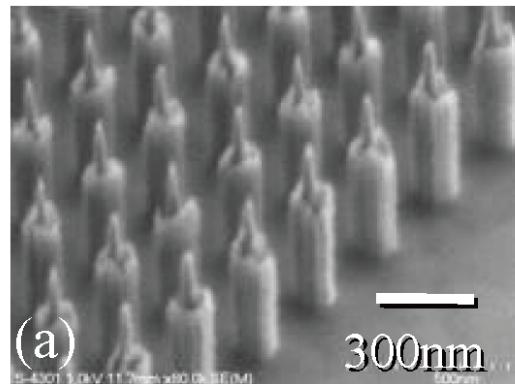


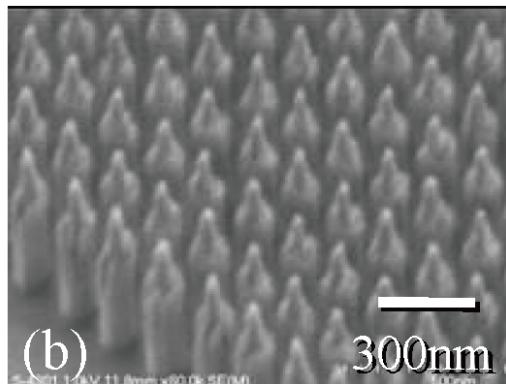
極微細加工・造形 共同研究支援例 住友電工(株) 高輝度ダイヤモンドナノエミッタの開発

細さ、密度共に世界初

(住友電工への共同研究支援: F広大H15-012)

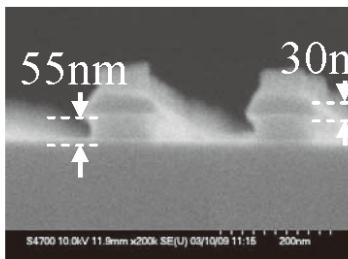


(a)

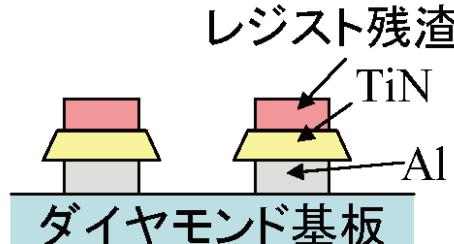


(b)

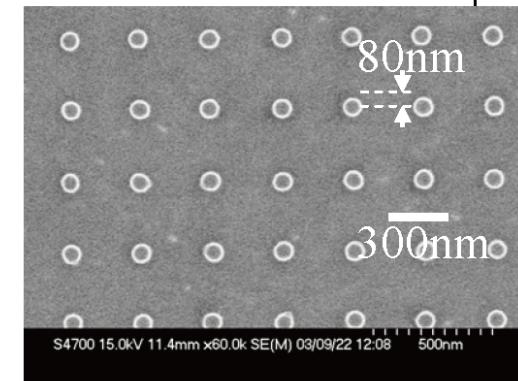
TiN / Alマスクにより形成したローソク型ダイヤモンドナノ突起
(a)300nm間隔、(b)200nm間隔



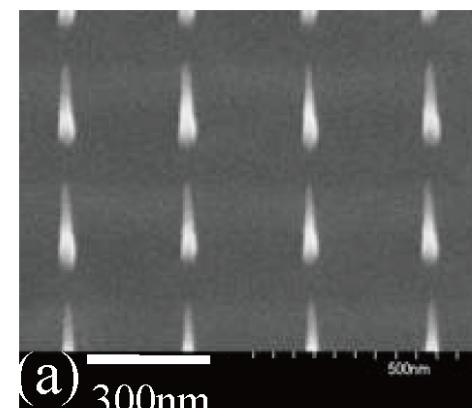
S4700 10.0kV 11.8mm x200k SE(U) 03/10/09 11:15



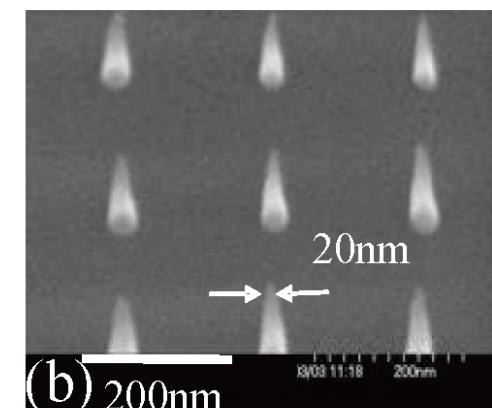
TiN/Alマスク断面図



a-Siマスク平面図



(a) 300nm



(b) 200nm

a-Siマスクにより形成したニードル型ダイヤモンドナノ突起
(a)300nm間隔、(b)200nm間隔